





دانشگاه ولی عصر رفسنجان

دانشکده علوم پایه

گروه فیزیک

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فوتونیک

عنوان:

بررسی خواص اپتیکی موجبر بلور فوتونی یک بعدی در حضور نانوذرات

فلزی

استاد راهنما:

دکتر مهدی سوبیزی

دانشجو:

سعید دبیری

دی ۱۳۹۳



دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
دانشکده‌ی علوم
گروه فیزیک

پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد
رشته‌ی فوتونیک

نام و نام خانوادگی دانشجو
سعید دبیری

عنوان پایان‌نامه

بررسی خواص اپتیکی موجبر بلور فوتونی یک بعدی در حضور نانوذرات فلزی

در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۳ توسط هیأت داوران زیر بررسی و با درجه‌ی عالی به تصویب نهایی رسید.

امضاء	مرتبه علمی	نام و نام خانوادگی	
	استادیار	دکتر مهدی سوزی	۱- استاد راهنما
	استادیار	دکتر مهدی شریعت	۲- داور داخل گروه
	استادیار	دکتر مسعود محبی	۳- داور داخل از گروه
	استادیار	دکتر مرضیه کهنوجی	۴- نماینده‌ی تحصیلات تکمیلی

تمامی حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات، ابتکارات و نوآوری‌های
حاصل از پژوهش موضوع این پایان‌نامه، متعلق به دانشگاه
ولی‌عصر (عج) رفسنجان است

با سپاس از سه وجود مقدس:

آمان که ناتوان شدند تا ما به توانایی برسیم...

موبایشان سپید شد تا ما رو سفید شویم...

و عاشقانه سوختند تا گرما بخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند...

پدرانمان

مادرانمان

استادانمان

...

این مجموعه را به پدر و مادر عزیزم تقدیم می‌کنم.

چکیده

یک دسته از قطعات اپتیکی که با بلورهای فوتونی ترکیب می‌شوند تارهای نوری (موجبرها) هستند که به چنین ساختارهایی تار بلور فوتونی می‌گویند. هدف در این پژوهش بررسی ویژگی‌های اپتیکی ساختارهای تار نوری بلور فوتونی کامل و ناقص آغشته به نانوذرات فلزی می‌باشد. می‌توان با ایجاد نقص در تناوب مذکور، یک حفره ایجاد کرد که این حفره باعث تشکیل مد نقص می‌شود. می‌توان با افزودن نانو ذرات فلزی در محل حفره به ساختار خواص اپتیکی آن را تغییر داد. در این پایان نامه موجبرهایی با دهانه‌ی بزرگ و کوچک بررسی شده است. در موجبرهایی که دهانه‌ی آن هم مقیاس با طول موج نور است تعداد مدهای مجاز محدود می‌شود. مدهای نقص در موجبرها با دهانه‌ی محدود به علت نداشتن بر هم نهی پهنای کمی داشته و تیز می‌باشند و این مزیتی برای سهولت آشکارسازی به حساب می‌آید. در این پایان نامه علاوه بر بررسی منحنی عبور نور از ساختار تک لایه، چند لایه و بلور فوتونی در قالب موجبر به بررسی تاثیر تغییرات شعاع و ضریب پراشگری نانوذرات فلزی بر روی مد نقص پرداخته شده است. قسمت دیگر این پایان نامه به بررسی اثر دما بر عملکرد حسگر موجبر بلور فوتونی که مبتنی بر تشدید پلاسمون‌های سطحی نانوذرات طلا توسط مد نقص می‌باشد، مربوط می‌شود. مشاهده گردید که تغییر دما منجر به تغییر شکل و ارتفاع مد نقص می‌شود. با توجه به پهنای بسیار کمتر قله‌ی مد نقص نسبت به قله‌ی تشدید پلاسمون سطحی در این پژوهش از تغییرات مد نقص به جای تغییرات ط پلاسمون سطحی به عنوان اساس کار حسگر دمایی استفاده شده است. تحلیل انتشار نور در ساختارهای تعریف شده در این پژوهش به روش ماتریسی انجام می‌شود.

واژگان کلیدی: بلور فوتونیک، تار بلور فوتونی، موقعیت نوار ممنوعه فوتونی، مد مشخصه‌ی نقص،

نانوذرات فلزی

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
فصل اول	۱
مقدمه	۱
۱-۱- مقدمه	۱
فصل دوم	۵
معرفی و تاریخچه	۵
۱-۲- مقدمه	۵
۲-۲- انواع بلورهای فوتونیکي	۶
۳-۲- ویژگی های بلورهای فوتونیکي	۷
۱-۳-۲- نوار ممنوعه ی فوتونیکي	۷
۲-۳-۲- نقص در بلور فوتونیکي	۹
۳-۳-۲- حالت های سطحی	۱۰
۴-۳-۲- کنترل نشر خود به خودی	۱۰
۴-۲- معایب بلور فوتونیکي دی الکتریکي	۱۲
۵-۲- بلور فوتونیکي فلزی	۱۲
۶-۲- کاربردهای بلور فوتونیکي فلزی	۱۳
۱-۶-۲- استفاده از نشر حرارتی به منظور ساخت نشر دهنده ها و جذب کننده های انتخابی و به کار بردن آن ها در سلول خورشیدی	۱۳
۲-۶-۲- به کارگیری بلورهای فوتونیکي فلزی در سلول خورشیدی	۱۴
۳-۶-۲- بلور فوتونیکي فلزی در آنتن ها	۱۶
۴-۶-۲- استفاده از بلور فوتونیکي در نشر دهنده های نوری	۱۷
۵-۶-۲- حسگر بلور فوتونیکي فلزی	۲۱
۷-۲- روش های ساخت	۲۱
۱-۷-۲- روش خود ساخت	۲۱
۲-۷-۲- لیتوگرافی	۲۲
۱-۲-۷-۲- لیتوگرافی لایه به لایه	۲۲
۲-۲-۷-۲- لیتوگرافی توسط باریکه نوری، یونی یا الکترونی	۲۳
۳-۷-۲- پرتو نگاری	۲۵

عنوان	صفحه
فصل ۳	۲۹
۱-۳- مقدمه	۲۹
۲-۳- نظریه ی ماتریسی برای لایه های نازک	۳۳
۳-۳- مدل درود	۳۷
۴-۳- مدل سلمیر	۴۳
۵-۳- مدل ماکسول - گارنت	۴۶
۶-۳- مدهای موجبر	۴۷
۱-۶-۳- بررسی مد TE	۴۸
۲-۶-۳- بررسی مد TM	۴۹
۳-۶-۳- معادل سازی	۵۰
فصل چهارم	۵۶
بررسی و تحلیل نتایج	۵۶
۱-۴- مقدمه	۵۶
۲-۴- ساختار تک لایه	۵۷
۱-۲-۴- ساختار تک لایه در حضور نانو ذرات طلا	۵۸
۲-۲-۴- مقایسه میزان عبور نور از ساختار تک لایه در حضور نانوذرات طلا و نقره	۶۰
۳-۲-۴- بررسی تاثیرات دمایی	۶۱
۱-۳-۲-۴- بررسی تاثیرات دمایی بر روی منحنی عبور نور در ساختار تک لایه ی	
سیلیکایی	۶۲
۲-۳-۲-۴- بررسی تاثیرات دمایی بر روی ساختار تک لایه ی سیلیکایی در حضور نانوذرات	
طلا	۶۳
۳-۴- ساختار چند لایه با تعداد لایه های کم	۶۶
۱-۳-۴- ساختار سه لایه ای در حضور نانوذرات طلا	۶۷
۱-۱-۳-۴- تاثیر ضریب پخش شدگی نانوذرات طلا بر روی منحنی عبور	۶۸
۲-۳-۴- مقایسه میزان عبور نور از ساختار سه لایه در حضور نانوذرات طلا و نقره	۷۰
۳-۳-۴- بررسی تاثیرات دمایی	۷۱

صفحه	عنوان
۷۱.....	۱-۳-۳-۴- بررسی تاثیرات دمایی بر روی منحنی عبور نور در ساختار سه لایه‌ای
۷۲.....	۲-۳-۳-۴- بررسی تاثیرات دمایی بر روی ساختار سه لایه‌ای در حضور نانوذرات طلا
۷۳.....	۴-۴- بلور فوتونی
۷۴.....	۱-۴-۴- ایجاد نقص در بلور فوتونی
۷۶.....	۲-۴-۴- حضور نانوذرات فلزی در مکان نقص
۷۷.....	۱-۲-۴-۴- تاثیر ضریب پراش نانوذرات طلا بر روی مدهای نقص
۷۸.....	۳-۴-۴- بررسی تاثیر تغییرات دما بر روی منحنی عبور نور از بلور فوتونی در حضور نانوذرات طلا
۷۹.....	۴-۴-۴- موجبر بلور فوتونی
۸۱.....	۵-۴-۴- تابش مایل
۸۲.....	۱-۵-۴-۴- بررسی اثرات دمایی بر روی مدهای نقص در تابش مایل نور
۸۴.....	فصل پنجم
۸۴.....	بررسی ساختار موجبر بلور فوتونی
۸۴.....	۱-۵- مقدمه
۸۵.....	۲-۵- تعیین تابع برازش شده‌ی ثابت انتشار
۸۸.....	۳-۵- تحلیل و بررسی ساختارهای مختلف چند لایه‌ای در قالب موجبر
۸۸.....	۱-۳-۵- ساختار موجبری تک لایه در حضور نانوذرات طلا و نقره
۹۱.....	۲-۳-۵- ساختار موجبری سه لایه در حضور نانوذرات طلا و نقره
۹۳.....	۳-۳-۵- ساختار موجبر بلور فوتونی
۹۶.....	۴-۵- تحلیل کمی شاخص‌های مختلف موجبر بلور فوتونی
۹۶.....	۱-۴-۵- بررسی میزان تاثیر تغییرات شعاع نانوذرات طلا بر روی مدهای نقص
۹۸.....	۲-۴-۵- بررسی کمی میزان تاثیر ضریب پراش نانوذرات طلا بر روی مد نقص
۱۰۱.....	۳-۴-۵- بررسی کمی میزان تاثیر دمای محیط شیشه‌ای بر جا به جایی مد نقص
۱۰۲.....	۴-۴-۵- بررسی کمی میزان تاثیر دمای نانوذرات طلا بر روی جا به جایی مد نقص
۱۰۴.....	۵-۴-۵- بررسی میزان تاثیر دمای ساختار نقص بر روی جا به جایی مد نقص
۱۱۱.....	۵-۵- ثابت انتشار میانگین
۱۱۲.....	۱-۵-۵- نوار ممنوعه‌ی فوتونی برای موجبر بلور فوتونی با ثابت انتشار میانگین

صفحه	عنوان
۱۱۶	فصل ششم.....
۱۱۶	نتیجه‌گیری و پیشنهادات.....
۱۲۰	منابع.....

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
شکل (۱-۲) (الف) بلور فوتونیکی سه بعدی، (ب) بلور فوتونیکی دو بعدی، (ج) بلور فوتونیکی یک بعدی.....	۷
شکل (۲-۲) (الف) پاشندگی در یک ماده با اختلاف بالا در ثابت های دی الکتریکی، (ب) پاشندگی در یک ماده تقریباً یکنواخت، (ج) نمودار پاشندگی در یک ماده همگن [۴].....	۷
شکل (۳-۲) تشکیل مد نقص در نوار ممنوعه ی فوتونیکی بعد از ایجاد نقص در ساختار [۴].....	۱۰
شکل (۴-۲) نحوه گیر افتادن پرتوها در یک زیر لایه ی همگن دی الکتریکی [۲۲].....	۱۶
شکل (۵-۲) تاثیر وجود بلور فوتونیکی به عنوان زیر لایه [۲۲].....	۱۷
شکل (۶-۲) تاثیر استفاده از بلور فوتونیکی در بازده خروجی دیود [۲۵].....	۱۸
شکل (۷-۲) (الف) یک ساختار دوره ای صفحه ای که اکثر نور توسط بازتاب داخلی کلی ، در داخل وسیله محبوس شده است. (ب) یک ورقه با ساختار بلور فوتونیکی که برخی از مدهای محبوس وجود دارد. (ج) ساختار ایده آل یک ورقه ی دو بعدی بلور فوتونیکی [۸].....	۲۰
شکل (۸-۲) ساخت بلور فوتونیکی از روش هولوگرافی [۳۵].....	۲۵
شکل (۹-۲) ساخت بلور فوتونیکی با استفاده از HOE [۳۶].....	۲۶
شکل (۱-۳) شرایط ایجاد تشدید پلاسمون سطحی در مرز بین فلز و دی الکتریک [۳۹].....	۳۱
شکل (۲-۳) بردارهای موج و میدان های الکتریکی مربوط به آنها برای تابش ساده در یک لایه ی منفرد دی الکتریکی [۴۱].....	۳۳
شکل (۳-۳) وابستگی ضریب شکست به انرژی فوتون و دما در شیشه ی سیلیکایی در دمای ۲۰.۵ درجه سانتی گراد [۴۶].....	۴۵
شکل (۴-۳) قسمت های حقیقی و مجازی گذردهی دی الکتریکی ساختار مرکب برای نانوذرات نقره ی محدود شده در شیشه ی سیلیکایی برای مقادیر $f = 0.2$ و $\epsilon d = 2.56$ [۴۷].....	۴۷
شکل (۵-۳) نمایش ساده ی موجبر با ضریب شکست n_2 بین دو محیط با ضریب شکست های n_1 و n_3	۴۷
شکل (۶-۳) رابطه ی بین β و k_2 و γ_2	۵۳
شکل (۱-۴) منحنی عبور نور از موجبر در حضور تک لایه ی سیلیکایی برای بازه ی طول موجی ۳۰۰ تا ۸۰۰ نانومتر.....	۵۸

شکل (۲-۴) میزان عبور نور از موجبر در حضور لایه‌ی سیلیکایی آغشته شده با نانوذرات طلا بر اساس تغییرات ضریب پراش برای مد TM ۵۹

صفحه

عنوان

شکل (۳-۴) مقایسه میزان عبور نور از موجبر در حضور لایه‌ی سیلیکایی آغشته شده با نانوذرات طلا و نقره با شعاع ۲۵ نانومتر و ضریب پراش ۰.۲ در فرکانس تشدید پلاسمون سطحی ۶۰	جدول (۲-۴) مشخصات نانو ذرات طلا و نقره به کار برده شده ۶۱
شکل (۴-۴) مقایسه‌ی منحنی عبور نور از موجبر در حضور تک لایه‌ی سیلیکایی در دو دمای ۲۰ و ۶۰ درجه سانتی گراد ۶۳	شکل (۵-۴) بررسی منحنی عبور نور از موجبر در حضور تک لایه‌ی سیلیکایی آغشته شده به نانوذرات طلا با شعاع ۲۵ نانومتر و ضریب پراش ۰.۲ در دو دمای مختلف ۶۴
شکل (۶-۴) بررسی میزان عبور نور از موجبر در حضور تک لایه‌ی سیلیکایی آغشته شده به نانوذرات طلا با شعاع ۲۵ نانومتر ضریب پراش ۰.۵ در دو دمای مختلف ۶۵	شکل (۷-۴) منحنی عبور نور از ساختار سه لایه‌ای ۶۷
شکل (۸-۴) منحنی عبور نور از ساختار موجبر در حضور سه لایه آغشته شده به نانوذرات طلا با شعاع ۲۵ نانومتر و ضریب پراش ۰.۲ ۶۸	شکل (۹-۴) تاثیر ضریب پراش نانوذرات طلا با شعاع ۲۵ نانومتر بر روی منحنی عبور نور از ساختار موجبر در حضور سه لایه ۶۹
شکل (۱۰-۴) مقایسه تاثیر حضور نانوذرات طلا و نقره با شعاع ۲۵ نانومتر بر منحنی عبور نور از ساختار موجبر با سه لایه ۷۰	شکل (۱۱-۴) بررسی تاثیر تغییر دمای سیلیکا بر روی منحنی عبور نور از ساختار موجبر با حضور سه لایه ۷۲
شکل (۱۲-۴) بررسی منحنی عبور نور از ساختار موجبر در حضور سه لایه آغشته شده به نانوذرات طلا با شعاع ۲۵ نانومتر ضریب پراش ۰.۲ در سه دمای مختلف ۷۳	شکل (۱۳-۴) منحنی عبور نور از بلور فوتونی با ۱۲ تناوب که نوار ممنوعه‌ی فوتونی در بازه‌ی طول موجی ۴۰۰ تا ۵۰۰ نانومتر قرار گرفته است ۷۴
شکل (۱۴-۴) منحنی عبور نور از ساختار بلور فوتونی با ۲۴ لایه که یک نقص به طول ۹۵۰ نانومتر و ضریب شکست ۱.۵ در وسط آن قرار دارد ۷۵	شکل (۱۵-۴) منحنی عبور نور از بلور فوتونی با ۲۴ لایه که یک نقص از جنس سیلیکا و به طول ۹۵۰ نانومتر در وسط آن قرار دارد ۷۶

شکل (۴-۱۶) تاثیر تشدید پلاسمون‌های سطحی بر روی مدهای نقص در ساختار بلور فوتونی ... ۷۷

<u>عنوان</u>	<u>صفحه</u>
شکل (۴-۱۷) مقایسه تاثیر ضریب پر شدگی نانوذرات طلا با شعاع ۲۵ نانومتر بر روی منحنی عبور نور از بلور فوتونی	۷۸
شکل (۴-۱۸) بررسی تاثیر تغییرات دما بر روی منحنی عبور نور از بلور فوتونی در حضور نانوذرات طلا با شعاع ۲۵ نانومتر و ضریب پرشدگی ۰.۲	۷۹
شکل (۴-۲۰) منحنی عبور نور از ساختار موجبر بلور فوتونی	۸۱
شکل (۴-۲۱) منحنی عبور نور از موجبر بلور فوتونی در تابش مایل با زاویه ۰.۰۵ رادیان	۸۱
شکل (۴-۲۲) بررسی تاثیر تغییرات دما بر روی مدهای نقص در تابش مایل نور با زاویه ۰.۰۵ درجه و ضریب پرشدگی ۰.۲ برای نانوذرات طلا	۸۲
شکل (۵-۱) ثابت‌های انتشار حاصل از برخورد منحنی‌های قسمت چپ و راست رابطه‌ی (۳-۵۸) برای موجبر با دهانه‌ی ۱ میکرون و با ضریب شکست مغزی ۱.۳ در طول موج ۵۰۰ نانومتر	۸۷
شکل (۵-۲) تابع برازش شده‌ی ثابت انتشار بر روی نقاط حاصل از حل عددی معادله‌ی مشخصه‌ی موجبر	۸۷
شکل (۵-۳) مقایسه منحنی عبور نور از موجبر تک لایه با دهانه‌ی کوچک در حضور نانوذرات طلا و نقره با ضریب پر شدگی ۰.۲	۸۹
شکل (۵-۴) مقایسه منحنی عبور نور از ساختار موجبر تک لایه برای موجبر با دهانه‌ی بزرگ (۱) و موجبر با دهانه‌ی کوچک (۲) در حضور نانوذرات طلا با شعاع ۲۵ نانومتر و ضریب پرشدگی ۰.۲	۹۰
شکل (۵-۵) مقایسه منحنی عبور نور از ساختار موجبر تک لایه برای موجبر با دهانه‌ی بزرگ (۱) و موجبر با دهانه‌ی کوچک (۲) در حضور نانوذرات نقره با شعاع ۲۵ نانومتر و ضریب پرشدگی ۰.۲	۹۱
شکل (۵-۶) مقایسه منحنی عبور نور از ساختار موجبر سه لایه برای موجبر با دهانه‌ی بزرگ (۱) و موجبر با دهانه‌ی کوچک (۲) در حضور نانوذرات طلا با شعاع ۲۵ نانومتر و ضریب پرشدگی ۰.۲	۹۲
شکل (۵-۷) مقایسه منحنی عبور نور از ساختار موجبر سه لایه برای موجبر با دهانه‌ی بزرگ (۱) و موجبر با دهانه‌ی کوچک (۲) در حضور نانوذرات نقره با شعاع ۲۵ نانومتر و ضریب پرشدگی ۰.۲	۹۲
شکل (۵-۸) منحنی عبور نور از موجبر بلور فوتونی با دهانه‌ی کوچک	۹۳
شکل (۵-۱۰) منحنی عبور نور از موجبر بلور فوتونی با دهانه‌ی کوچک در حضور نانوذرات طلا	۹۵

- شکل (۱۱-۵) مقایسه منحنی عبور نور از موجبر بلور فوتونی تعریف شده در بخش (۴-۴-۱) با دهانه‌ی بزرگ (۱)، و موجبر بلور فوتونی با دهانه‌ی کوچک (۲) ۹۵
- شکل (۱۲-۵) بررسی تاثیر تغییر شعاع نانوذرات طلا بر روی ارتفاع مد نقص ۹۷

صفحه

عنوان

- شکل (۱۳-۵) منحنی میزان تغییر ارتفاع مد نقص نسبت به تغییر شعاع نانوذرات طلا ۹۷
- شکل (۱۴-۵) مقایسه‌ی موقعیت مد نقص نسبت به تغییر ضریب پراش نانوذرات طلا در ساختار موجبر بلور فوتونی ۹۸
- شکل (۱۵-۵) میزان تغییر ارتفاع مد نقص نسبت به تغییر ضریب پراش نانوذرات طلا ۹۹
- شکل (۱۶-۵) میزان جا به جایی مد نقص نسبت به تغییرات ضریب پراش ۱۰۰
- شکل (۱۷-۵) شماتیک حسگر مستقیم ضریب پراش و شعاع نانوذرات معلق در سیال ۱۰۱
- شکل (۱۸-۵) مقایسه‌ی موقعیت مد نقص نسبت به تغییرات دمایی محیط سیلیکایی ۱۰۲
- شکل (۱۹-۵) مقایسه‌ی موقعیت مد نقص نسبت به تغییرات دما برای نانوذرات طلا ۱۰۳
- شکل (۲۰-۵) میزان تغییر ارتفاع مد نقص نسبت به تغییرات دمای نانوذرات طلا ۱۰۳
- شکل (۲۱-۵) مقایسه‌ی موقعیت مد نقص به ازای تغییرات دمای محیط نقص شامل محیط سیلیکایی و نانوذرات طلا ۱۰۵
- شکل (۲۲-۵) میزان تغییر ارتفاع مد نقص نسبت به تغییر دمای محیط نقص ۱۰۶
- شکل (۲۳-۵) میزان تغییر ارتفاع مد نقص نسبت به تغییر دمای محیط نقص برای ضریب پراش ۱۰۷
- ۰.۲ شعاع ۵۰ نانومتر ۱۰۷
- شکل (۲۴-۵) میزان تغییر ارتفاع مد نقص نسبت به تغییر دمای محیط نقص برای ضریب پراش ۱۰۸
- ۰.۲ شعاع ۱۵ نانومتر نانوذرات طلا ۱۰۸
- شکل (۲۵-۵) منحنی تغییر ارتفاع مد نقص بر حسب تغییرات دما برای ضریب پراش ۰.۳
- نانوذرات طلا با شعاع ۲۵ نانومتر ۱۰۹
- شکل (۲۶-۵) منحنی تغییر ارتفاع مد نقص نسبت به تغییر دما برای ضریب پراش ۰.۳ و شعاع ۳۰ نانومتر برای نانوذرات طلا ۱۱۰
- شکل (۲۷-۵) منحنی تغییر ارتفاع مد نقص نسبت به تغییر دما برای ضریب پراش ۰.۳ و شعاع ۱۵ نانومتر نانوذرات طلا ۱۱۱
- شکل (۲۸-۵) مقایسه منحنی عبور نور از ساختار موجبر بلور فوتونی با تابع برازش شده ثابت انتشار، منحنی ۱، و با ثابت انتشار میانگین، منحنی ۲ ۱۱۳

شکل (۵-۲۹) مقایسه‌ی منحنی عبور نور از موجبر بلور فوتونی در حضور نانوذرات طلا با شعاع ۲۵ نانومتر و ضریب پراش ۰.۲ با فرض تابع برازش شده‌ی ثابت انتشار، منحنی ۱، و ثابت انتشار میانگین، منحنی ۲..... ۱۱۴

فهرست جدول‌ها

عنوان	صفحه
جدول (۴-۱) میزان عبور نور از ساختار تک لایه‌ی سیلیکایی در حضور نانوذرات طلا برای ضرایب پراش مختلف	۵۹
جدول (۴-۲) مشخصات نانو ذرات طلا و نقره به کار برده شده	۶۱
جدول (۴-۳) بررسی و مقایسه عبور نور در ساختار تک لایه‌ی سیلیکایی در حضور نانو ذرات نقره و طلا	۶۱
جدول (۴-۴) ثابت‌های مدل سلمیر وابسته به دما برای شیشه‌ی سیلیکایی [۴۶]	۶۲
جدول (۴-۵) میزان عبور نور از تک لایه‌ی سیلیکایی آغشته به نانوذرات طلا با ضریب پراش ۰.۲	۶۵
جدول (۴-۶) میزان عبور نور از تک لایه‌ی سیلیکایی آغشته به نانوذرات طلا با ضریب پراش ۰.۵	۶۵
جدول (۴-۷) تاثیر ضریب پراش نانوذرات طلا بر میزان عبور نور از ساختار سه لایه‌ای	۶۹
جدول (۴-۸) بررسی و مقایسه عبور نور در ساختار سه لایه‌ای در حضور نانو ذرات نقره و طلا	۷۱
جدول (۴-۹) میزان عبور نور از ساختار سه لایه‌ای آغشته به نانوذرات طلا با ضریب پراش ۰.۲	۷۳
جدول (۴-۱۰) تاثیر تغییرات دما بر روی مکان مدهای نقص ساختار بلور فوتونی	۷۹
جدول (۴-۱۱) میزان تغییر ارتفاع و مکان مدهای نقص بر اثر تغییرات دما	۷۹
جدول (۴-۱۱) میزان تغییر ارتفاع و مکان مدهای نقص بر اثر تغییرات دما	۸۲

فصل اول

مقدمه

۱-۱- مقدمه

یک دسته از ادوات اپتیکی که با بلورهای فوتونی قابل ترکیب شدن هستند تارهای نوری (موجبرها) هستند که به چنین ساختارهایی تار بلور فوتونی می گویند. موضوع بلورهای فوتونیک از مباحث علمی است که در سالهای اخیر کاربردهای بسیار وسیع آن در حوزه‌ی پژوهش‌های بنیادی و همچنین در فناوری مورد توجه پژوهشگران بسیاری قرار گرفته است. بلورهای فوتونیک ترکیبی از دی الکتریک دوره‌ای یا ساختارهای فلز- دی الکتریک دوره‌ای می‌باشند که به منظور تحت تاثیر قرار دادن انتشار امواج الکترومغناطیسی عمل می‌کنند. در چند سال گذشته راسل و همکارانش با شناخت و تحقیق در مورد تارهای بلور فوتونی در این زمینه پیشگام شدند. این دسته از تارها در ابعاد میکرو به نانو برای بوجود آوردن موجبرهایی با خواص انتشاری جدید نسبت به تارهای معمولی استفاده شده اند [۱].

بلورهای فوتونیک بر اساس تنوع ابعادشان دسته بندی می شوند. همان طوری که در پاراگراف قبل اشاره شد، وجود ساختاری با ضریب شکست دوره‌ای، موجب ایجاد ساختار نواری می شود. موادی که ثابت دی الکتریک دوره ایشان به صورت فضایی در یک جهت تغییر می کند، بلور فوتونیک یک بعدی هستند [۲]. از انواع دیگر بلورهای فوتونیک می توان به بلورهای فوتونیک دو بعدی و سه بعدی اشاره کرد که به ترتیب ثابت دی الکتریکشان در دو یا سه جهت مستقل تغییر می کند [۳].

در سال های اخیر تارهای بلور فوتونی که یک نقص بر آنها اعمال شده است اهمیت زیادی را بخاطر خواص منحصر به فردشان بدست آورده اند که این خواص در تارهای معمولی دیده نمی شود. اگر در محیط نقص از نانوذرات فلزی استفاده شود، در مرز بین فلز و دی الکتریک می توان پدیده ی تشدید پلاسمون سطحی را مشاهده کرد که با توجه به خواص ترمو اپتیکی محیط دی الکتریکی و نانوذرات فلزی فرکانس تشدید را می توان تحت تاثیر تغییرات دما قرار داد و از این خاصیت به عنوان اساس کار یک حسگر دمایی استفاده کرد.

تاکنون خواص متفاوتی از تارهای بلور فوتونی از قبیل: گستره ی وسیع فرکانسی در عملکرد تک مدی، ناحیه مدی وسیع، پراش (پراکندگی) قابل تنظیم و خاصیت دو شکستی بالا گزارش شده است. تارهای بلور فوتونی با خاصیت دو شکستی زیاد می توانند در موارد گوناگونی از قبیل ارتباطات نوری یا حسگرهای تار نوری استفاده شوند [۵].

در اغلب پژوهش هایی که در مورد موجبرها و کاربردهای آنها انجام می شود، دهانه ی موجبر با ابعاد بزرگ در نظر گرفته می شود. در اینگونه موجبرها تعداد مدهایی که مجاز به انتشار می باشند بسیار زیاد است از آن رو ثابت انتشار مدها به صورت پیوسته در نظر گرفته می شوند. از این رو مدهای نقص ساختار به دلیل بر هم نهی پهن می باشند که تشخیص جا به جایی آنها دشوار است و قابلیت آشکارسازی آنها به صورت جداگانه وجود ندارد. در این راستا با کوچک کردن دهانه ی موجبر تعداد مدهای مجاز بسیار محدود شده و مدهای نقص به علت نداشتن بر هم نهی پهنای کمی دارند و تیز می باشند، بنابراین آشکارسازی آنها راحت تر می باشد. در فصل چهارم این پایان نامه موجبر با دهانه بزرگ و در فصل پنجم موجبر با دهانه ی کوچک به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد و سپس در فصل پنجم به مقایسه ی آنها پرداخته می شود.

در فصل دوم به معرفی بلورهای فوتونیک، ویژگی، کاربرد و روش ساخت آنها پرداخته و تاریخچه ی مختصری از آن بیان می شود.

در فصل سوم به چگونگی حل مسئله با استفاده از روش ماتریسی و معرفی مدل‌های مورد استفاده در این پژوهش از جمله مدل درود، سلمیر و ماکسول-گارنت پرداخته شده است.

در فصل چهارم و پنجم نتایج تحلیلی به دست آمده برای موجبرهایی با دهانه‌ی بزرگ و کوچک در حالت‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرند.

قابل ذکر است که در این پژوهش از نرم افزار ممتیکا و متلب جهت انجام محاسبات کمک گرفته شده است.

فصل دوم

معرفی و تاریخچه

۲-۱- مقدمه

قرن‌هاست پژوهشگران به دنبال راهی برای کنترل ویژگی‌های مواد هستند. پیشرفت‌ها در متالوژی، سرامیک، پلاستیک، دانشمندان را قادر به کنترل ویژگی‌های فیزیکی مواد کرده است. همچنین پیشرفت‌ها در فیزیک نیمه رساناها آنها را قادر به کنترل ویژگی‌های رسانندگی مواد کرده است.

یک بلور نیمه رسانا با آرایش دوره ای از اتم‌ها یا مولکول‌ها، پتانسیلی دوره ای برای انتشار یک الکترون در داخل آن را ایجاد می‌کند. این پتانسیل دوره ای در یک بلور نیمه رسانا به وسیله ی تعریف نوار انرژی ممنوعه ی الکترونی به روی رفتار الکترون، به واسطه ی پراش براگی شکل از اتم‌ها تاثیر می‌گذارد. بنابراین الکترون‌ها برای انتشار در جهات معلوم، ممنوعیت پیدا می‌کنند. حال اگر پتانسیل به اندازه‌ی کافی قوی باشد، این ممنوعیت به تمامی جهت‌ها گسترش می‌یابد و یک نوار ممنوعه ی کامل را تولید می‌کند.

در دهه‌ی اخیر پیشرفت در بلورهای فوتونیک دانشمندان را قادر به کنترل ویژگی‌های اپتیکی مواد کرده است. بلورهای فوتونیک ترکیبی از دی الکتریک دوره ای یا ساختارهای فلز- دی الکتریک دوره‌ای می‌باشند که به منظور تحت تاثیر قرار دادن انتشار امواج الکترومغناطیسی به همان شکلی که نیم رساناها به روی انتشار الکترون‌ها اثر می‌کنند.